InxAl1-xAs alloy 유전함수와 전이점 연구

윤재진¹, 김영동¹, D. E. Aspnes², 김혜정³, Y. C. Chang³, 송진동⁴

¹Nano-Optical Property Laboratory and Department of Physics, Kyung Hee University, Seoul 130-701, Korea
²Department of Physics, North Carolina State University, Raleigh, NC 27695, U.S.A.
³Department of Physics, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, IL, U.S.A.

⁴Center for Spintronics Research, Korea Institute of Science and Technology, Seoul, KOREA

InAlAs alloy system은 InP 및 GaAs 계열의 고 전자 이동도 트랜지스터 (HEMTs)와 IC응용 기술 등에 사용되고 있고 전자 통신 및 디바이스 산업에서 넓은 응용범위를 갖고 있지만 다른 화합물에 비해 전이점 연구 및 광 특성 연구가 미흡한 실정이다. 본 연구에서는 타원 편광 분석법을 이용하여 $1.5\sim 6$ eV 의 분광 영역에서 인듐 조성비를 각기 (x=0.1, 0.43, 0.62, 0.75, 및 1.00) 다르게 한 $In_xAl_{1:x}$ As alloy의 유전함수를 측정하였다. 또한 표면에 자연 산화막을 제거하기 위하여 Methonol과 DI Water로 표면을 세척 한 후 NH4OH, Br in Methonol 등으로 적절한 화학적 에칭을 하여 산화막을 제거함으로서 그림 1과 같이 순수한 InAlAs의 유전함수를 측정할 수 있었다. 측정된 InAlAs 유전함수를 Standard analytic CP line shape 방법으로 인듐 조성비에 따른 에너지 전이점을 얻을 수 있었다. 또한 얻어진 에너지 전이점 값을 이용하여 Davenport와 그의 연구진들이 발전시킨 InAlAs 방법으로 밴드 구조 계산을 하였고, 이를 바탕으로 InAlAs 전이점 지역의 여러 전이점 (InAlAs) 유전함 InAlAs 사용한 경고, 인를 바탕으로 InAlAs 지역의 여러 전이점 (InAlAs) 사용한 전이점 InAlAs 사용한 전이점 사용한 전이점 연구 및 물성 분석은 InAlAs 레모운 전이점 (InAlAs) 사용한 정보가 될 것이다.





